平成24年度

卒業論文

ダブルベータ崩壊の探索

神戸大学 理学部物理学科

磯江 麻衣
 岡本 慧太
 佐金 拓耶
 林 央樹
 矢ヶ部 遼太

目 次

第 1章	ダブルベータ崩壊観測の理論的背景 (担当:佐金 拓耶)	1
1.1	ダブルベータ崩壊..................................	1
	1.1.1 ベータ崩壊	1
	1.1.2 ダブルベータ崩壊	1
	1.1.3 ダブルベータ崩壊原子と期待されるイベントレート	3
1.2	ガス検出器による電子検出................................	5
	1.2.1 曲率半径と運動エネルギー	5
	1.2.2 ガスの最適化	$\overline{7}$
1.3	まとめ	11
第2章	実験装置 (担当:矢ヶ部 遼太)	12
2.1	検出器と検出原理...............................	12
	2.1.1 μ -PIC (Micro Pixel Chamber)	12
	2.1.2 GEM (Gas Electron Multiplier)	13
	2.1.3 μ -TPC(Micro Time Projection Chamber)	14
2.2	磁石の設計と磁場のシュミレーション........................	16
	2.2.1 磁石モデル	16
	2.2.2 解析結果	18
	2.2.3 磁石設計のまとめ	22
笛3音	シミュレーション (担当・林・中樹)	7 3
77 J 	シミュレーションの概要	20 23
3.1	シミュレーションの設定	20 23
0.2	3.2.1 Count / とけ	20 23
	3.2.1 Geanly Cla	20 22
2.2	5.2.2 平大峡ての00 ···································	20
0.0	电」の運動エイルィー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
	3.3.1 · · · · · / 朋家による电」の形動 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	24
	3.3.2 / 1 / / 1 / / による电」 派動の曲半十任の等山	24
	3.3.3 电」の理動エイルイ ···································	20
24	3.3.4 所切力仏	21
0.4	(火山谷、の女祖 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	29
	3.4.1 ルヘス/L	29
	3.4.2 リンノリンノビソノ	00 91
	3.4.3 世国刀杵能 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	01 20
	3.4.4 快山協安市、	32
第4章	実機による測定	33
4.1	ガス利得の測定 (担当:岡本 慧太)	33
	4.1.1 セットアップ	33
	4.1.2 ガス利得の測定方法	34
	4.1.3 ガス利得の測定結果	35
	4.1.4 ガス利得のまとめ	36

4.2	電子の	多重散乱の測定 (担当:岡本 慧太)	37
	4.2.1	⁶⁰ Coを線源に用いた測定	37
	4.2.2	多重散乱の測定結果	38
	4.2.3	多重散乱のまとめ	42
4.3	宇宙線	μ粒子を用いた位置分解能とサンプリングピッチの測定	
		(担当:礒江麻衣)	42
	4.3.1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	42
	4.3.2	μ 粒子の飛跡の取得	44
	4.3.3	ガス利得の測定..............................	45
	4.3.4	サンプリングピッチの測定	46
	4.3.5	サンプリングピッチの測定結果	47
	4.3.6	検出器の位置分解能の測定	48
	4.3.7	位置分解能の測定結果	49
	4.3.8	位置分解能とサンプリングピッチのまとめ	53
第5章	まとめ		54
5.1	ダブル	ベータ崩壊を観測するための要請	54
5.2	実験結	果	54
謝辞			55
参考文南	ť		56

第1章 ダブルベータ崩壊観測の理論的背景

(担当:佐金 拓耶)

1.1 ダブルベータ崩壊

1.1.1 ベータ崩壊

ベータ崩壊は原子核内の中性子が弱い相互作用により、電子と反ニュートリノを放出して より安定な原子核に遷移する過程のことである。ベータ崩壊の式は以下のようになる。

$$(Z, A) = (Z + 1, A) + e^{-} + \bar{\nu}_e$$
 (1.1)

ここでZは原子番号、Aは質量数である。また実際には次のような反応が原子核内で起こる。

$$\mathbf{n} \to \mathbf{p} + \mathbf{e}^- + \bar{\nu}_{\mathbf{e}} \tag{1.2}$$

1.1.2 ダブルベータ崩壊

ダブルベータ崩壊は原子核内の2つの中性子が同時にベータ崩壊する現象である。エネル ギー準位の関係からベータ崩壊を起こす事はできないが、ダブルベータ崩壊のみ可能な原子 核が存在する。また、ダブルベータ崩壊には2つのモードがある。1つは原子核内で通常の ベータ崩壊が2度同時におこる過程で、2つの電子と2つの反電子ニュートリノがそれぞれ 生じる。これが2νモードと呼ばれており、様々な原子核で観測されている。この崩壊過程 は質量数A、陽子数Zとすると以下のようになる。

$$(Z, A) = (Z + 2, A) + 2e^{-} + 2\bar{\nu}_e$$
 (1.3)

一方、ニュートリノを放出しない 0v モードでは、ダブルベータ崩壊の際にニュートリノを 放出せず、電子2つのみがでてくる反応である。これは、ニュートリノがマヨラナ粒子である ことを示している。しかし、現在のところ未観測であり、KamLAND-Zen 実験やCANDLES 実験などで探索が行われている。

また 0ν モードの崩壊過程は以下のようになる。

$$(Z, A) = (Z + 2, A) + 2e^{-}$$
 (1.4)

電弱相互作用の標準模型によると、原子核の電荷が変化するベータ崩壊は、常に弱い相互 作用を媒介する荷電 W ボソンを経由して起こる。すなわち、中性子を構成する d クォーク が u クォークになり(中性子は陽子になる)、この荷電クォークカレントが W⁻ ボソンと結 合する。W⁻ ボソンは荷電レプトンカレントと結合し、電子と反ニュートリノが放出される. 従って、図 1.1 に模式的に示した 2 つの崩壊モードは 図 1.2 のダイアグラムで表される。



図 1.1: 崩壊モードの模式図



図 1.2: ββ崩壊2つの崩壊モードの Feynman 図。左が2νモード、右が0νモード

ダブルベータ崩壊のエネルギースペクトルは、2レモードの場合にはニュートリノが運動 エネルギーを持ち去るので、2つの電子のエネルギーの和は連続スペクトルになる。一方、 0レモードで生じる電子のエネルギーの和はニュートリノが生じないために崩壊前と崩壊後 のエネルギー差であるQ値と一致する。このような違いから、2つの電子のエネルギースペ クトルを測定する事で、図1.3のようなエネルギー分布が得られる。2つのモードを分離で きるエネルギー分解能をもつ検出器であれば、0レモードの事象はQ値でピークを持つよう なスペクトルとして観測される。



図 1.3: ダブルベータ崩壊で期待されるエネルギースペクトル

1.1.3 ダブルベータ崩壊原子と期待されるイベントレート

ダブルベータ崩壊を起こす原子核を表1に挙げる。 0ν モードは未観測であるため寿命はすべて下限値である。これら原子核の中から、寿命や存在比を考慮して今回は¹⁰⁰Moを用いて崩壊頻度を計算した。¹⁰⁰Moは原子番号 Z = 42、原子量 A = 100、密度 ρ = 10.128g/cm³ である。崩壊過程は (5) 式及び図 1.4 のように示される。

$$^{100}\text{Mo} \rightarrow ^{100}\text{Ru} + 2e^- + 2\bar{\nu}_e$$
 (1.5)



図 1.4: ¹⁰⁰Moのダブルベータ崩壊に関連したエネルギー準位

		F *		
原子核	Q値 (MeV)	$2 u\beta\beta$ の寿命(× 10^{21} 年)	$0 u\beta\beta$ の寿命(× 10^{21} 年)	存在比(%)
⁴⁸ Ca	4.271	0.04	> 14	0.187
$^{76}\mathrm{Ge}$	2.040	1.74	> 15700	7.8
$^{82}\mathrm{Se}$	2.995	0.096	> 9.5	9.2
^{100}Mo	3.034	0.57	> 4.9	9.6
¹³⁰ Te	2.533	0.7	> 210	34.5

表 1.1:

この崩壊でのQ値は3.03MeVで、電子の最大エネルギーは1.5MeVである。平均寿命は 0.58×10²¹年である。本研究では10cm³の3次元飛跡検出器の使用を考えているので、図 1.5のような厚さ0.01cm、縦10cm、横10cmのモリブデン箔の崩壊率を計算する。 まず、この1.0cm³のモリブデン薄中の¹⁰⁰Moの数を計算する。 この箔中の¹⁰⁰Moの質量は

$$10.28[g/cm^3] \times 1.0[cm^3] = 10.28[g]$$
 (1.6)

なので、含まれる¹⁰⁰Moの数は

$$10.28[g] \times 95.94[g/mol] \times 6.02 \times 10^{23}[個/mol] \times 0.0967 = 6.24 \times 10^{21}[個]$$
 (1.7)

となる。

また、時間 dt で崩壊する原子核の平均の数は

$$dN = -\lambda N dt \tag{1.8}$$

として表される。ここでλは崩壊定数、N は原子の数である。ここから t 秒経過したときの 数は

$$N(t) = N(0) \exp(-\lambda t)$$
(1.9)

ここで N(0) は t = 0 の時の原子の数。寿命は原子の数は $\frac{1}{e}$ となる時間である。このときの 崩壊率は 1 ヶ月あたり

$$\frac{\Delta N}{\Delta t} = \frac{(6.238 \times 10^{21})}{0.58 \times 10^{21}} \times \frac{1}{e} \times \frac{1}{12} [\square/\square] = 0.33 [\square/\square]$$
(1.10)

この結果から実際の研究ではモリブデン薄を3枚入れれば1ヶ月に1発程度観測出来ると 予想される。



図 1.5: モリブデン薄

1.2 ガス検出器による電子検出

1.2.1 曲率半径と運動エネルギー

ダブルベータ崩壊によって生じた電子のエネルギーを測定するためには曲率半径から運動 量を求め、そこから運動エネルギーを求める。 仮に今、¹⁰⁰Mo から出た電子が x-y 平面状で図 1.6 のように円運動したと仮定する。



図 1.6: 電子の磁場中での運動の模式図

この時、運動量 p と曲率半径 R との関係は、相対論的な結果は古典的な結果に一致するので、

$$mv = p = qBR \tag{1.11}$$

という結果が得られる。ここでmは電子の質量、Bは磁場の大きさ、qは電子の電荷の大き さである。本実験では10cm³の三次元飛跡検出器を用いるので、運動エネルギーK = 1MeV の電子が放出されたときに曲率半径 R = 5cm 程度になるように磁場をかけたい。 1MeV の電子のもつ全エネルギー E は

$$E = K + mc^{2} = 1[MeV] + 0.511[MeV] = 1.511[MeV]$$
(1.12)

である。また E と運動量 pc の関係は次のような関係がある。

$$E = \sqrt{(mc^2)^2 + (pc)^2}$$
(1.13)

よって (13) 式からこのときの運動量 pc を求めると、pc = 1.42MeV である。よって (11) 式 を用いて、運動エネルギー 1MeV の電子が曲率半径 5cm で飛ぶようにするためには、

$$B = \frac{pc}{qcR} = 0.1[T]$$
(1.14)

の磁場が必用である。

この磁場のもとで曲率半径とエネルギーの関係は図 1.7 のようになる。このグラフは横軸に 曲率半径、縦軸に放出された電子の運動エネルギーをとりプロットしたものである。こから 高いエネルギーであればおよそ ΔE = ΔR となる事が分かる。



図 1.7: 曲率半径と運動エネルギーの関係。横軸は曲率半径 (cm) で縦軸は運動エネルギー (MeV)

1.2.2 ガスの最適化

本年度の研究では電子を検出するための検出器のパラメーターを設定する。このために ⁶⁰Coのガンマ線によるコンプトン散乱からの電子を用いた。これに先立って計算を行い、 CF₄ と Ar のガスを、(1) 多重散乱の大きさ、(2) 得られる信号の大きさ、の点で比較する。

(1) 多重散乱の大きさ

物質中を通過する荷電粒子は多数回の小角度の散乱によりその進行方向が変えられる。こ のほとんどが原子核とのクーロン散乱のために起こるので、この効果は多重クーロン散乱 (multiple Coulomb scattering)と呼ばれる。この散乱角度分布は小さい角度において、分 布はおおよそガウス分布になるが、散乱角度が数 θ_0 (後で定義する)よりも大きい角度に おいては散乱角度分布がガウス分布で期待されるよりも大きい。この多重散乱が小さいほど 曲率半径を正確に測定可能となりエネルギー分解能がよくなる。 今、三次元的な分布を二次元に投影した分布を

$$\theta_0 = \theta_{\text{plane}}^{\text{rms}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \theta_{\text{space}}^{\text{rms}} \tag{1.15}$$

と定義すると大角度の散乱を行なわない限り散乱角度の分布は、多くの場合においてガウ ス近似で十分であり、その広がりは

$$\theta_0 = \frac{13.6[\text{MeV}]}{\beta \text{cp}} \cdot z \sqrt{x \cdot \rho / X_0} [1 + 0.038 \ln(x/X_0)]$$
(1.16)

$$X_0 = \frac{716.4[\text{gcm}^{-2}]A}{Z(Z+1)\ln(287/\sqrt{Z})}$$
(1.17)

で表される。ここで Z は電荷、A は質量数、 X_0 は放射長、x は物質の厚さ、cp は運動量である。



図 1.8: 縦軸イベント数、横軸角度の正規分布

(16)、(17) 式に表 1.2 の値と x = 10[cm] を代入することで、1 気圧のガス中での運動量 1MeV の電子の多重散乱を考える。このときの角度は

CF₄ ガスのとき
$$\theta_0=15[度]$$

Ar ガスのとき $\theta_0=13[\overline{\rho}]$

表 1.2: 検討したガスの性質

ガス	密度 (g/cm^3)	Z	A	放射長	β	pc(MeV)
CF_4	3.7×10^{-3}	42	88	34	0.89	1.4
$\mathrm{ArC}_{2}\mathrm{H}_{6}$	1.7×10^{-3}	36	70	20	0.89	1.4



図 1.9: 角度の気圧依存性とエネルギー分解能の関係

図 1.9 のグラフは横軸が気圧、縦軸が角度のグラフである。気圧が大きくなるにつれ多重 散乱角 θ_0 は大きくなるので、できるだけ気圧を下げガスを薄くした方が良い事がわかる。 図 1.7 から 1MeV 付近のエネルギーでは $\Delta E \propto \Delta R$ なので、崩壊の最初と終わりの 2 点で 考えると、エネルギー分解能と位置分解能の関係は次のようになる。

$$\theta_0 = \frac{10[\text{cm}]}{\Delta \text{R}} \cdot \frac{\pi}{180} \tag{1.18}$$

この関係から図 1.9 にはエネルギー分解能 20 %と 15 %の線を引いた。また、エネルギー分 解能 20 %以下であれば、バックグラウンドとダブルベータ崩壊によって放出された電子を 区別できるはずであるので、予定している 3 次元検出器でダブルベータ崩壊を観測するには 0.2 気圧以下が望ましい。また、参考までに KamLAND-Zen で 0 ν ダブルベータ崩壊を観測 する際のエネルギー分解能は $\theta_0 = 1.2$ [度] に相当する。

(2) 信号の大きさ

荷電粒子は物質中に入ると物質中の原子と電磁相互作用をすることによりエネルギーを 失う。このエネルギー損失は主に物質中で束縛された電子をイオン化することによって生じ る。ここでいうイオン化とは、物質中で束縛された電子が物質中に入ってきた荷電粒子から 相互作用によりエネルギーを受け取り、 束縛から解き放たれて運動することである。この エネルギー損失から得られる信号の大きさを考えていく。

まず、荷電粒子が入射してきたときのエネルギー損失は

$$\left(\frac{\mathrm{dE}}{\mathrm{dX}}\right)_{\mathrm{total}} = \left(\frac{\mathrm{dE}}{\mathrm{dX}}\right)_{\mathrm{rad}} + \left(\frac{\mathrm{dE}}{\mathrm{dX}}\right)_{\mathrm{coll}} \tag{1.19}$$

で表される。(些)_{rad}は制動放射によるエネルギー損失を表し、(些)_{coll}は衝突によるエネ ルギー損失を表している。

また $\left(\frac{dE}{dX}\right)_{rad} = \left(\frac{dE}{dX}\right)_{coll}$ となるエネルギーを臨界エネルギー E_c と定義され次の式で表される。

$$E_{c} = \frac{1600m_{e}c^{2}}{Z}$$
 (1.20)

 $E < E_c$ では衝突によるエネルギーが優勢であり、 $E > E_c$ のときは制動放射によるエネル ギー損失が優勢となる。Ar ガスの場合、 $E_c = 45$ [MeV]、 CF_4 ガスの場合 $E_c = 19.5$ [MeV] である。今考えている、電子のエネルギーは 1MeV 程度なので、制動放射によるエネルギー 損失は考慮しなくて良いことになる。荷電粒子が物質中で電子をイオン化することにより失 うエネルギーは Bethe-Bloh の方程式から導かれる以下の式を用いる

$$-\frac{dE}{dx} = 2\pi N_{\rm a} r_{\rm e}^2 c^2 \rho \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2} \left[\ln \frac{\tau^2(\tau+2)}{2(I/m_{\rm e}c^2)^2} + F(\tau) - \delta - 2\frac{C}{Z} \right]$$
(1.21)

$$F(\tau) = 1 - \beta^2 + \frac{\frac{\tau^2}{8} - (2\tau + 1)\ln 2}{(\tau^2 + 1)^2}$$
(1.22)

$$\frac{I}{Z} = \begin{cases} 12 + \frac{7}{Z}ev & (Z < 13)\\ 9.76 + 58.8Z^{-1.19}ev & (Z \ge 13) \end{cases}$$
(1.23)

r _e :	電子の半径	I: 平均隆起エネルギー	β :入射粒子の速度	δ: 密度補正
m _e :	電子の質量	Z: 原子番号	A :吸収物質の原子量	C: 殻補正
N _a :	アボガドロ数	<i>ρ</i> : 吸収物質の密度	β :入射粒子の速度	τ: 運動エネルギー

観測の対象となっている電子は 1MeV 程度なので、(23) 式の密度補正 δ と殻補正 C は無 視出来る。(23)、(24)、(25) 式に表 2 の値を代入して、1MeV の電子が 1 気圧中を走ったと きのエネルギー損失を考えると、

CF₄ガスのとき

$$-\frac{\mathrm{dE}}{\mathrm{dx}} = 5.8[\mathrm{keV/cm}] \tag{1.24}$$

Ar ガスのとき

$$-\frac{\mathrm{dE}}{\mathrm{dx}} = 2.4 [\mathrm{keV/cm}] \tag{1.25}$$

となる。 CF_4 のW値は54eV、ArのW値は26eVなので、400 μ mピッチあたりの電子の 個数を考えると、Arのとき、1cm あたりに出てくる電子の数Nは

$$N = \frac{2.4[keV/cm]}{26[eV]} = 92.3[fm/cm]$$
(1.26)

400µm あたりの個数 n は

$$n_{\rm Ar} = 92.3 \times 10^{-4} \times 400 = 3.6 [\text{@}/400 \mu \text{m}]$$
(1.27)

同様に CF₄ ガスの時

$$n_{CF_4} = \frac{5.8[\text{keV/cm}]}{54[\text{ev}]} \times 400 \times 10^{-4} = 4.0[\text{@}/400\mu\text{m}]$$
(1.28)

となる。1ストリップあたりに落とされる電子の数は大きな違いは無く、どちらのガスを使った場合でも同等のガス利得が必要となる事ことがわかる。放出される電子のエネルギーを変えて計算すると、図 1.10 のようなグラフになる。



図 1.10: 1 ストリップあたりの電子の数と、放出された電子のエネルギーの関係 (横軸:電子の運動エネルギー 縦軸:1 ストリップあたりの電子の数)

ここから、1MeV の電子を観測するためのガス利得について考えてみる。アンプのスレッ ショルドを q_{th} とすると、

$$q_{\rm th} = G_{\rm gas} \cdot q \tag{1.29}$$

である。ここで q を 1 ストリップあたりの電荷、G_{gas} をガスゲインとした。今回用いる 装置のスレッショルドは q_{th} = 13[fc] である。1 ストリップあたりの電荷量が q_{th} より小さ いと信号を確認出来ない。(31) 式に q = 4 × 1.6 × 10⁻¹⁹、q_{th} = 13[fc] を代入すると、

$$G_{gas} = \frac{q_{th}}{q} = \frac{13[fc]}{4 \times 1.6 \times 10^{-19}[C]} = 2.0 \times 10^4$$
(1.30)

となるので、1 気圧のとき 1MeV の電子を観測するには (32) 式よりガス利得は最低でも 2×10^4 が必要である。よって一般的には

ガス利得 =
$$\frac{2 \times 10^4}{P}$$
 (P:気圧) (1.31)

となる。

1.3 まとめ

ダブルベータ崩壊には 2 ν モードと 0 ν モードがある。本実験では、三次元飛跡検出器に よってダブルベータ崩壊 2 ν モードの観測を目的としている。そのためにこの章では、¹⁰⁰Mo をターゲットとした時のイベントレートの計算と、1MeV の電子を観測するための装置の 条件を数値計算した。その結果、1MeV の電子を測定するには磁場 B = 0.1[T]、ガス利得 = $\frac{2 \times 10^4}{P}$ 以上で、0.2 気圧以下のガスを用いる必用がある事が分かった。また、これらに、シ ミュレーションからの要請を加え検出器への要請とする。

第2章 実験装置 (担当:矢ヶ部 遼太)

第2章では、実験装置について述べる。図2.1 は、最終的に予定されている装置の構成図であ り、大きく2つの部分に分けられる。 1つ目は荷電粒子の検出器で、2つ目は磁石で ある。 第2.1節で荷電粒子検出器であるµ-TPC と

第 2.1 即で何電松子検出器であるμ-1PC と その検出原理について述べ、第 2.2 節で磁石の 設計と磁場のシュミレーションについて述べる。



図 2.1: 本実験で設計する実験装置の外観。 飛跡検出器と、検出領域に一様な磁場を発 生させるための磁石からなる。

2.1 検出器と検出原理

本実験では、荷電粒子の電荷情報と3次元飛跡を再構成するためにµ-PICを用いたµ-TPC を使った。以下に、その装置の概要を示す。

2.1.1 *µ*-PIC (Micro Pixel Chamber)





図 2.2: *µ*-PIC の概形



本実験で用いた µ-PIC は、10 × 10 cm² の検出面積を持ち、直交する 256 本のストリップ が基板の両面に 400 µ m 間隔で形成されている。各ストリップからの出力はアンプに入力 される。中心の陽極付近の強い電場により電子が加速され、ガス分子をイオン化させる。それによって生じた電子が、また同じように加速されて周りの原子をイオン化させる。これを 繰り返すことにより電子雪崩を起こして大きな電気信号に変換することで、荷電粒子の通過 位置が測定可能となる。μ-PICのガス利得は最大で~10⁴である。μ-PIC単体では、欲し いガス利得を得られないので、本実験では、GEM とμ-PIC を組み合わせて使った。

2.1.2 GEM (Gas Electron Multiplier)

本実験で用いた GEM は、厚さ 100 μ m の液晶ポリマーの両側に、厚さ 5 μ m の銅が蒸 着されたものである。140 μ m ピッチで直径 70 μ m の穴があけられており、両側の電極 に電位差を与えることで、穴の中に電場を作り、穴を通る電子がガス増幅される。GEM の ガス利得は最大で~10² であり、 μ -PIC と GEM を合わせた全体としてガス利得は~10⁵ で ある。



図 2.4: GEM 付近の電気力線



図 2.5: GEM による電子雪崩の様子 ([9] 参照)

2.1.3 *µ*-TPC(Micro Time Projection Chamber)



図 2.6: チェンバーの概形

図 2.6 に示されているようにチェンバーの外形は、 $28 \times 28 \times 17 \text{cm}^3$ で、上部は 3mm の ステンレス、下部は 16.7mm のアルミニウムで構成されている。



図 2.7: 検出器の概形



図 2.8: 検出器内の構造

検出器内の構造は、上の図 2.7、図 2.8 に示されている。図 2.8 のドリフト空間は 13 × 13 × 10 cm³ であり、上部は 5mm の PTFE と 100 μ m のアルミニウム、側面は 10mm の PTFE で構成されている。内側には、一定の間隔で銅線が張られてあり、これによってドリ フト空間中に一定の電場がかかるようになっている。検出器内を荷電粒子が通ると、検出器 内に満たされているガスが電離される。電離された電子は、ドリフト空間中の電場により一 定の速度でドリフトされ、GEM と μ -PIC により増幅される。こうして増幅された電子は、 アノードとカソードのストリップで電気信号として捉えられ、 μ -PIC から xy 平面上での位置を、時間情報 (100MHz) によりドリフトした距離を求めることで z 位置を読み取ることが できる。このようにして荷電粒子の 3 次元飛跡を検出する。



図 2.9: μ-TPC による荷電粒子の位置情報の読み取り

粒子の飛跡の検出回路システムの概要を図 2.9 に示す。まず、検出器面に到達した増幅さ れた電子の電荷情報を、ASD でデジタル情報に変換しポジションエンコーダーに送信する。 この信号は、ポジションエンコーダーで処理され、メモリーボードに送られて記録される。 図 2.10 は、μ-TPC による荷電粒子 (μ粒子)の3次元飛跡の一例である。



図 2.10: µ-TPC による荷電粒子の3次元飛跡の再構成(µ粒子)

2.2 磁石の設計と磁場のシュミレーション

本実験では、検出器 (µ-TPC) を磁場中に設置し、荷電粒子の曲率半径を測定をすること で、電子の運動エネルギーを測るが、このときに磁場の一様性がエネルギー分解能に影響す る。そこで、µ-PIC を含むガス検出器内の中心磁場強度 (0.1T) からのずれが、± 20%に収 まる程度の一様な磁場を作り出せる磁石の設計を行った。なお、この程度の磁場の非一様性 のエネルギー分解能への影響は、GEANT4(後述)を用いた見積もりが必要であるが、本研 究においてはそのシュミレーションには至っていない。

2.2.1 磁石モデル

以下に、現実的に実現可能である磁石のモデルについてその具体的な規格や特性を示す。



図 2.11: 検討している磁石の概形([8])

- 総重量約250kg
- 励磁電流 15A
- 励磁電圧 20V

- 温度上昇(Δ t) 30 °C
- 冷却方式 自然空冷
- 磁極間隙 150mm

このモデルに関して、図 2.12 のように x 軸をとったときの磁場強度の変化を図 2.13 に示す。



図 2.12: x 軸の取り方 ([8])



図 2.13: 磁極間隙中心における中心磁場強度からの変化([8])

- x=0[mm] 磁場 B=0.116[T]
- x=50[mm] 磁場 B=0.098[T]
- x=-50[mm] 磁場 B=0.101[T]

中心磁場強度からのずれ 約15% 中心磁場強度からのずれ 約13%

これから分かるように、x 軸上の磁場については、確かに中心磁場強度からのずれが±20%に収まっている。しかし、図 2.14 の z 軸方向の磁場の変化は分からないので、この方向における磁場の変化のシュミレーションを行った。このシュミレーションには、Maxwell 3D という電磁場解析ソフトを用いており、磁石の具体的な規格については、図 2.11 の設計図に基づいて設計した。図 2.14 に、シュミレーションで使った磁石モデルのジオメトリを示す。磁極間隔の中心を原点とし、図 2.14 のように座標系をとった。

磁石モデルのパラメタ

- 鉄:比透磁率~2000
- 銅線部分 (図のトーラス部分)
 :比透磁率~0.999991
- 巻き数~500
- 電流~15A

10cm V 13cm 0 7 z 15cm 55cm 58cm

図 2.14: シュミレーションにおける磁石モデル。 実際には、図の下の磁極部分にも銅線(トーラス) が巻いてあるが、磁石単体での外形を見やすくす るため省いた。

2.2.2 解析結果

以下に、解析結果を示す。



図 2.15: z=0[mm] の平面上での磁場強度の 図 2.16: 図 2.15 で示される平面の位置 分布



図 2.17: z=0[mm]の平面中心からの距離に対する磁場強度の変化

図 2.15 に、z=0[mm] の平面上での磁場強度の分布、図 2.16 に、図 2.15 で示される平面 の位置、図 2.17 に、この平面中心からの距離における磁場強度の変化を示す。 円板の中心磁場強度は、0.116T。円板の中心から 50mm 離れたところでの磁場強度は 0.093T で、中心磁場強度からのずれは 19.8%程度である。



図 2.18: 業者モデルとの比較

図 2.18 は、x=0[mm] の点での磁場強度の値を一致させて、現実に検討している磁石モデ ルとの距離に対する磁場強度の変化を比較したものである。x=50[mm] のときの磁場強度の 値で、業者から提示されたモデルを基準にして考えると、約 5%程度のずれがあるので、以 下の議論では、この程度の誤差を考慮して考える必要がある。



図 2.19: z=50[mm] の平面上における磁場強 図 2.20: 図 2.19 で示される平面の位置 度の分布



図 2.21: z=50[mm] の平面中心からの距離に対する磁場強度の変化

図 2.19 に、z=50[mm] の平面上での磁場強度の分布、図 2.20 に、図 2.19 で示される平面 の位置、図 2.21 に、この平面中心からの距離における磁場強度の変化を示す。 図 2.19 の円板の中心磁場強度は、0.159T。円板の中心から 50mm 離れたところでの磁場強 度は 0.149T で、中心磁場強度からのずれは 6.3%程度であり、±5%の誤差を考慮に入れて も欲しい精度をみたしている。この平面では、中心の平面と比べると、磁場強度の変化が緩 やかだが、これは z=50[mm] の平面がより磁極に近く、他の平面と比較して磁束が広がらな いためと考えられる。



図 2.22: y=0[mm] の平面上における磁場強度 図 2.23: 図 2.22 で示される平面の位置の分布



図 2.24: y=0[mm]の平面中心からの距離に対する磁場強度の変化

図 2.22 に、y=0[mm] の平面上での磁場強度の分布、図 2.23 に、図 2.22 で示される平面 の位置、図 2.24 に、この平面中心からの距離における磁場強度の変化を示す。 図 2.22 の円板の中心磁場強度は、0.116T。円板の中心から 50mm 離れたところでの磁場強 度は 0.159T で、中心磁場強度からのずれは 27.9%程度であり、±5%の誤差を考慮に入れて も±20%の一様さに収まりきれていない。これは、磁極に近いほど電流による磁場が強いた めと考えられる。 磁極方向における磁場強度の変化を少なくするためには、磁極半径を大 きくするとよいが、そうすることで重量と銅線の巻き数が増え、それに従って、発生する熱 量も大きくなるので、これを実行するのは難しい。

2.2.3 磁石設計のまとめ

以下に、磁石設計に関してまとめる。

- 検出器を設置できる磁極間隔を持ち、中心磁場強度からのずれが、少なくとも検出器の範囲内においては±20%程度のずれに収めることができる磁石を設計したい。
- 業者による設計と磁場計算によると、磁極間隔の条件と、磁極間隔中心における検出 器と平行な平面上での磁場の一様性は満たされていることが分かったが、それと垂直 な方向での磁場の一様性が分からない。
- 業者から提示されたモデルを元に Maxwell 3D を用いて解析を行った結果、磁極方向 における磁場強度の変化が大きいことが分かった。
- 現在、提示されたモデルを基にした磁石の製作を考えている。業者の提示したモデルでは、磁石の軸上の磁場強度は±20%以内に収まるが、検出器全体について磁場強度をシュミレートしたところ、最大で約30%のずれがあることが判明した。より良いモデルについて業者とさらに検討を重ねる。

第3章 シミュレーション (担当:林 央樹)

3.1 シミュレーションの概要

1章では理論計算によって、検出器に対して 0.2 気圧以下が必要という要請が与えられた。 ここではまず、シミュレーションを行うために Geant4 を使って実際の検出器のジオメトリ を再現し、磁場中を運動する電子の曲率半径から、電子の運動エネルギー、エネルギー分 解能を求める。その後、気圧、サンプリングピッチ、位置分解能を変えてそれぞれのエネル ギー分解能を求め、ダブルベータ崩壊を検出するために必要とされるエネルギー分解能を得 るためのガスパラメータを、理論計算からの要請に加えて、検出器に要請する。

3.2 シミュレーションの設定

3.2.1 Geant4 とは

今回シミュレーションには Geant4 を用いた。Geant4 とは、粒子と物質の反応のシミュ レーションを行うための C++ベースのソフトウェア・ツールキットである。粒子が物質中で 起こす複雑な振る舞いを、乱数を用いて計算するモンテカルロ法に基づいてシミュレーショ ンすることができる。

3.2.2 本実験での設定

本実験で使われている検出器を図 3.1 のように再現した。気体中の粒子の多重散乱、エネ ルギーロス、(磁場による効果)はGeant4によってランダムに計算される。また、検出器の ジオメトリを作る際に、内側の立方体を 512 × 512 × 512 分割し、それによってできたひと つひとつの小さな立方体をセンサーとしているため、130[mm]/512 ~ 0.25[mm] 間隔で x,y,z 座標それぞれの位置での反応が記録される。



図 3.1: 検出器の概要 (13×13×13[cm])

また、封入するガスとして、本実験で使用した Ar : C₂H₆ = 9 : 1、Ar : C₂H₆ = 7 : 3、CF₄ を用意し、さらに、z 軸正方向に 0.1T の磁場をかける。

3.3 電子の運動エネルギー

3.3.1 ベータ崩壊による電子の飛跡

検出器のジオメトリを組むことができたので、目的とする電子の運動エネルギーを求める。ダブルベータ崩壊による電子を見たいが、まずは適当なガスを選び検出器の中心で⁴⁰K をベータ崩壊させてみると電子の飛跡は図 3.2 のようになる。

 $Ar: C_2H_6 = 9: 1, 0.5 \ {\Xi}E$



図 3.2: ⁴⁰K のベータ崩壊による電子の飛跡 (10event)

⁴⁰K のベータ崩壊の Q 値は 1.3MeV であり、1MeV の電子の曲率半径が 5cm 程度である ことを考えると、図 3.2 の xy 平面で電子の曲率半径からおおよそ正しいシミュレーション になっていることがわかる。

次に、曲率半径を求めるために円でフィッティングすることを考えるが、ベータ崩壊によっ て図 3.2 のようにランダムな方向・運動エネルギーで飛ぶ電子に対応できるフィッティング のプログラムを考えることは現時点では難易度が高い。

そのため、フィットしやすい飛跡についてのアルゴリズムを開発した。

3.3.2 フィッティングによる電子飛跡の曲率半径の導出

今回、曲率半径を求めるために用いたフィッティングの関数は、中心座標 (x₀,y₀)、半径 R の

$$y = +(R^2 - (x - x_0)^2)^{1/2} + y_0$$
(3.1)

という半円の式である。したがってこの関数で最もフィットしやすい電子の飛跡を得るため には、磁場の向きを考えて、電子を検出器の中心からy軸正方向に射出してやればよい。こ の設定で、1MeV で射出した電子の飛跡は図 3.3 のようになる。



図 3.3: (0,1,0) 方向に 1MeV で射出した電子の飛跡 (1event)

またこの時、よりきれいな円弧を得るため、多重散乱の効果を考えてガスを Ar : C₂H₆ = 7 : 3、 0.1 気圧とした。この xy 平面の飛跡に対して 3.1 式の半円でフィットを行うと図 3.4 のよう になる。



図 3.4: 図 2.13 の xy 平面のフィット結果

この時の得られたパラメータは、

- $x_0 = -51.91 \pm 0.33$ [mm]
- $y_0 = -11.98 \pm 0.25 \text{ [mm]}$
- $R = 53.40 \pm 0.33 \text{ [mm]}$

である。

図中の赤線がフィット関数を表していて、きれいに電子の飛跡と重なりうまくフィッティン グできていることがわかる。また、半径も正しいものを得ることができた。

3.3.3 電子の運動エネルギー

フィッティングにより得られた曲率半径から、電子の運動エネルギーを求める。まず電子 の運動量を求めるが、この時使う式は

$$pc_{xv}[eV] = 3.0 \times 10^8 \cdot B[T] \cdot R[m]$$
(3.2)

で、pc_{xy} は xy 平面での電子の運動量、B は磁場の強さ、R は電子の曲率半径である。検出 器には z 軸正方向に 0.1T の磁場をかけているので、B=0.1 として、R にはフィットした結 果の曲率半径を代入する。

この時得られる電子の運動量は xy 平面に射影されたものなので、さらに z 成分を考えてや る必要がある。図 3.3 の yz 平面の電子の飛跡を見ると、電子は水平方向に対してある角度 を持って出てきている。図 3.5 に示すようにこの角度をθとする。



図 3.5: *θ*の定義

また、本来このように運動量の z 成分を考えるときは yz 平面だけでなく xz 平面も考慮に 入れる必要があるが、今回は電子を y 軸正方向に射出していて、かつ知りたいのは電子が出 た直後の角度なので yz 平面だけを見ている。こうして求めた θ を、

$$pc = pc_{xy}/\cos\theta \tag{3.3}$$

に代入して電子の運動量 pc を得る。最後に、

$$T = ((mc^2)^2 + (pc)^2)^{1/2} - mc^2$$
(3.4)

に電子の質量 $mc^2 = 511$ [keV] とともに電子の運動量 pc を代入すれば電子の運動エネルギー T を求めることができる。

3.3.4 解析方法

電子の運動エネルギーのヒストグラムを出す際、エネルギー分解能をより良くするため に、電子がなるべくきれいな円軌道を描くイベントを選別してから運動エネルギーを計算し ている。

全事象に対しての電子の運動エネルギーのヒストグラムを、図 3.6 に示す。

 $Ar: C_2H_6 = 9: 1, 0.1 \ \Xi E$



図 3.6: 電子の運動エネルギー (選別前, *σ*_{res}=0.2)

得られたヒストグラムの RMS は 27%程度であるが、これは期待されるエネルギー分解能 よりはるかに悪い。多重散乱などで円軌道からはなれた電子のイベントを削れば、エネル ギー分解能がより良くなると考えられる。そこで、円でフィットする際に下のように χ² を 定義する。

$$\chi^2 \equiv \sum_{i} \left(\frac{Y^{(i)} - \mu^{(i)}}{\sigma} \right)^2 \left(= \chi^2_{root} \times \left(\frac{\sigma^2_{sim}}{\sigma^2_{sim} + \sigma^2_{res}} \right) \right)$$

 χ^2 は、電子の軌道の、フィット関数である半円からのおおよその離れ具合を示す。ここで、Y⁽ⁱ⁾は観測値 (=Geant4 で計算された値)の y 座標、 $\mu^{(i)}$ は期待値 (=フィットした半円上の各点)の y 座標で、 σ はシミュレーションによる誤差 σ_{sim} と位置分解能による誤差 σ_{res} を使って

$$\sigma = \sqrt{\sigma_{\rm sim}^2 + \sigma_{\rm res}^2}$$

と表される。今回 $\sigma_{sim}=0.447$ [mm] としていて、 σ_{res} は位置分解能を固定している時は0mm、 位置分解能を変化させている時は有限の値を持つ。また、 χ^2_{root} はフィットの結果として得ら れる値で、

$$\chi^2_{\rm root} \equiv \sum_{\rm i} \left(\frac{{\rm Y}^{\rm (i)} - \mu^{\rm (i)}}{\sigma_{\rm sim}} \right)^2$$

と定義されている。この χ^2 が比較的大きいイベントを排除すれば、きれいな円軌道を描く 電子のイベントだけを選別できる。具体的に、Ar : C₂H₆ = 9 : 1, 0.1 気圧の時の χ^2 は図 3.7 のようになっている。



図 3.7: χ^2 のヒストグラム ($\sigma_{res} = 0.2$)

この図を見ると、 $\chi^2 < 2000$ のイベントのみ見るようにすれば、効率を保ったまま、エネルギー分解能が良くなると期待される。実際にそのような方法で作ったヒストグラムが図 3.8 で、先ほどと比べて分布の RMS は半分程度になり、かつ選択効率も 50%程度で高く保 てている。このようにして事象を選別し、電子の運動エネルギー、そしてエネルギー分解能を求めた。



図 3.8: $\chi^2 < 2000$ のイベントを選んで作った電子の運動エネルギーのヒストグラム ($\sigma_{\rm res}=0.2$)

(1) エネルギー分解能

フィッティングしやすいイベントに対して、電子の運動エネルギーを求めることができる ようになったので、運動エネルギーのヒストグラムを作る。ガス、気圧の設定は次の通りで、 今まで通り 1MeV で電子を射出する。得られたエネルギースペクトルを図 3.9 に示す。

 $Ar: C_2H_6 = 9: 1, 0.1 \ {\mbox{\pounds}} E$



図 3.9: 電子の運動エネルギー (ガウスフィット済)

期待通り 1MeV にピークが立っているので、正しく運動エネルギーを求めることができ ている。このときのヒストグラムをガウシアンでフィットした結果のσを電子の運動エネル ギーの分解能とし、σにつくエラーをエネルギー分解能のエラーとする。このときのガス、 気圧の設定でエネルギー分解能は

$14 \pm 0.424\%$

となる。

3.4 検出器への要請

ダブルベータ崩壊を検出するためにはある程度以上の精度のエネルギー分解能が必要となる。ここで、実機に対してガスの気圧、データのサンプリングピッチ、検出器の位置分解能の条件を要請するために、それぞれを変化させて同じように電子のエネルギー分解能を調べる。今回の実験では Ar: C₂H₆ = 9:1のガスを使ったので、ガスの種類は固定する。

3.4.1 ガス気圧

ガスの気圧を上げると、電子のガス中での多重散乱の効果が大きくなり、その結果エネル ギー分解能が悪くなる。

そのため、まずサンプリングピッチを 0.25mm、位置分解能を 0mm に固定して、ガスの気 圧を 0.1~1.0 気圧まで 0.1 気圧ずつ変えて、気圧とエネルギー分解能の関係を見る。理論計 算で求めたエネルギー分解能と合わせてグラフにしたものを図 3.10 に示す。





図 3.10: 気圧とエネルギー分解能の関係 (* は理論計算で求めたエネルギー分解能、エラー バー付きのプロットは Geant4 による結果をもとに解析したエネルギー分解能)

理論計算では多重散乱の角度からエネルギー分解能を出していて、最初のデータ点と最 後のデータ点しか見ていないが、Geant4 では各点で多重散乱の効果を考慮しているので、 グラフで傾きに差が現れる。つまり気圧が高く散乱角が大きい時には理論計算よりもシミュ レーションの結果の方が良い結果となるが、低い気圧の領域でエネルギー分解能はおおよそ 一致しているので、ここでもシミュレーションの正当性がわかる。 そしてグラフトb エネルギー分解能 2000 を必要してれば、ガスの気圧は0.2 気圧以下が検

そしてグラフより、エネルギー分解能 20%を必要とすれば、ガスの気圧は 0.3 **気圧以下**が検 出器に要請される。

3.4.2 サンプリングピッチ

サンプリングピッチとは、飛跡における長さあたりのデータ点の数の逆数である。例え ば、長さ 1cm の飛跡の中に 10 個のデータ点があれば、そのサンプリングピッチは 1mm で ある。検出器のガス利得やガス気圧が低いと、このサンプリングピッチは大きくなる。そこ で、ガスの気圧を 0.1 気圧、位置分解能を 0mm に固定してサンプリングピッチを変化させ、 サンプリングピッチとエネルギー分解能の関係を調べる。 μ -PIC の陽極、陰極のストリッ プは 400 μ m ピッチなので、0.4~10mm のサンプリングピッチでエネルギー分解能を見る。 ここでもエネルギー分解能 20%を必要とすると、図 3.11 よりサンプリングピッチは 1mm **以 下**が必要となる。 $Ar:C_2H_6=9:1$



図 3.11: サンプリングピッチとエネルギー分解能の関係

3.4.3 位置分解能

最後に、気圧を 0.1 気圧、サンプリングピッチを 0.25mm に固定して位置分解能とエネル ギー分解能の関係を調べる。

今回実験で用いたような TPC(Time Projection Chamber) の位置分解能 σ_{res} は、あとの章 で言及しているが、検出器特有の分解能 $\sigma_{detector}$ と、ドリフトによる分解能 $\sigma_{diffusion}$ を用いて

$$\sigma_{\rm res} = \sqrt{\sigma_{\rm detector}^2 + \sigma_{\rm diffusion}^2}$$

と表され、二次元ガウス分布となる。

したがって、位置分解能をこちらで変化させる時には下図のように Geant4 で得られた真の 値を動かすが (今回は簡単のため二次元でのみ移動させている)、動かす距離 r は二次元ガウ ス分布に従うランダムな変数とする必要がある。また、θ は 0~2π rad で一様にランダムと している。



図 3.12: データ点を動かす

二次元ガウス分布の分布関数は、

$$\mathbf{f}(\mathbf{r}) = \frac{\sqrt{2\pi}}{\sigma} \operatorname{rexp}\left(-\frac{\mathbf{r}^2}{2\sigma^2}\right)$$

であり、実際にrがこの分布に従っているか確かめるために、横軸rの一次元ヒストグラム を作ると図 3.13 のようになっていて、確かに二次元ガウス分布に従う乱数であることがわ かる。



図 3.13: r のヒストグラム ($\sigma = 0.2$)。二次元ガウス関数でフィットしている

こうして、あとは位置分解能 σ の数値を動かしてエネルギー分解能を評価した。図 3.14 より、エネルギー分解能 20%が欲しければ、位置分解能は 1.4mm **以下**が必要となる。

 $Ar: C_2H_6 = 9:1$



図 3.14: 位置分解能とエネルギー分解能の関係

3.4.4 検出器要請へのまとめ

エネルギー分解能 20%の精度に対する検出器への要請

- 気圧は 0.3 気圧以下
- サンプリングピッチは 1mm 以下
- 位置分解能は 1.4mm 以下

第4章 実機による測定

4.1 ガス利得の測定 (担当:岡本 慧太)

4.1.1 セットアップ

実機によるガス利得の測定を行った。用いたガスはAr: $C_2H_6 = 9:1$ の混合ガスで、チェンバー内の気圧は 0.2 気圧である。またこの測定に用いた線源は COOL-X という X 線発生 装置 (図 4.1) である。図 4.2 に示すように COOL-X の内部には圧電素子があり、加熱と冷却 を周期的に繰り返すことによって X 線を発生する。加熱時には圧電素子の上面が正に帯電 し、COOL-X に封入してあるガス中の電子が圧電素子上面にコートしてある Ta に衝突する ことによって、Ta の特製 X 線が放射される。その X 線のエネルギーは 8.14keV である。圧電素子が暖まりきると、圧電素子を冷却する。冷却時には圧電素子の上面は負に帯電するため、ガス中の電子は圧電素子と逆の方向に進む。そして、コートしてある Cu に電子が衝突 することによって Cu の特製 X 線が放射される。その時の X 線のエネルギーは 8.05keV で ある。過熱時と冷却時のどちらの場合も特製 X 線の他にも制動放射によって γ 線が放射されるイベントも起こるが、それは特製 X 線が放射されるイベントよりもかなり少ないので、今回の測定では考えない。つまり線源からは 8.14KeV と 8.05KeV の X 線が放射されていると 考える。



図 4.1: COOL-X の外観



図 4.2: COOL-X の内部構造

4.1.2 ガス利得の測定方法

COOL-X から放射される X 線は検出器内で光電吸収反応を起こし電子とイオンのペアを 生成する。

$$\operatorname{Ar} \mathcal{O} W \ \acute{\mathrm{ld}} = 26 [\mathrm{eV}] \tag{4.1}$$

$$C_2 H_6 \mathcal{O} W \ interface{1.2}{in$$

であるので COOL-X から放射される X 線によって生成される電子の電荷は

$$\frac{8.1[\text{keV}]}{26[\text{eV}]} \times (1.6 \times 10^{-19}[\text{C}]) = 5.0 \times 10^{-17}[\text{C}]$$
(4.3)

となる。この電荷にガス利得とアンプによる利得を掛けた電荷が観測される。その電荷と FADCによって記録された波形 (図 4.3)の時間による積分値の関係は以下の式で表される。

$$5.0 \times 10^{-17} \cdot G_{\text{gas}} \cdot G_{\text{amp}} = \frac{\int_{t} \text{FADCdt}}{255} \cdot \frac{1}{50} \cdot (10 \times 10^{-9})$$
(4.4)

なおここで G_{gas} はガス利得、G_{amp} がアンプによる電荷の利得を表しており G_{amp} = 160 で ある。なお FADC は8ビットであるため 255 が 1V に対応しており、FADC 値を 255 で割る と出力される信号の電圧となる。また抵抗値は 50 Ω であるので、信号の電圧を抵抗値で割 ることで信号の電流となる。FADC の波形は 10ns に 1 点記録されるので信号の電流に 10ns を掛けることで増幅された信号の電荷となる。



図 4.3: FADC による波形データ

4.1.3 ガス利得の測定結果

アノードの印加電圧とガス利得の関係を調べた。図 4.4 から図 4.9 はそれぞれのアノード の印加電圧での FADC の積分値のヒストグラムである。それらのヒストグラムの最もイベ ント数が大きい値を読んでいき、その FADC の積分値を式 (1.1) に代入してガス利得を求め た。結果を表 4.1 に示す。

アノードの印加電圧 [V]	スペクトルのピーク値	ガス利得
320	80	0.75×10^4
330	110	1.0×10^4
340	140	1.2×10^4
350	160	1.6×10^4
360	220	2.2×10^4
370	280	2.8×10^{4}

表 4.1: アノードの印加電圧とスペクトルのピーク値とガス利得





図 4.4: アノードの印加電圧 370V



図 4.6: アノードの印加電圧 350V

図 4.5: アノードの印加電圧 360V



図 4.7: アノードの印加電圧 340V



図 4.8: アノードの印加電圧 330V

図 4.9: アノードの印加電圧 320V

この結果を縦軸にガス利得、横軸にアノードの印加電圧としてプロットしていった (図 4.10)。なお縦軸は log scale である。得られた結果を指数関数でフィットした結果

$$y = \exp[2.7 \times 10^{-2} \times x + 0.29]$$
(4.5)

を得た。これより 0.2 気圧で電子を観測するのに必要なガス利得 10⁵ を達成するにはアノー ドの印加電圧は 416V 必要であることが解る。



図 4.10: ガス利得の電圧依存性

4.1.4 ガス利得のまとめ

• 0.2 気圧の Ar : $C_{2}H_{6} = 9:1$ の混合ガスでガスゲインカーブの測定を行った。本測定 では 0.2 気圧で電子の飛跡を観測するのに必要な gas gain 10^{5} を得ることはできなかっ たが anode の印加電圧を 416V まで上げれば、それは達成可能という予測を得た。

4.2 電子の多重散乱の測定 (担当:岡本 慧太)

4.2.1 ⁶⁰Co を線源に用いた測定

線源には ⁶⁰Co を用いて電子の多重散乱の測定を行った。⁶⁰Co は図 4.11 のような崩壊を 起こす。



図 4.11:⁶⁰Coの崩壊図

今回の測定では1.17MeVと1.33MeVのy線に着目する。これらのy線がチェンバー内に 入射すると、y線はガス中の電子とコンプトン散乱を起こす。本測定では、コンプトン散乱 によって反跳された電子の飛跡を2次元に射影したものを観測する。反跳された電子はガス 中の分子で多重散乱される。測定データに対して、始めの3点を直線でフィット、終わりの 3点を直線でフィットしてそれらがなす角度を多重散乱角として解析した。(図 4.12)



図 4.12: 測定した反跳電子の飛跡と多重散乱角の定義。青とオレンジの直線のなす角を多重 散乱角と定義した。この図で線源の⁶⁰Co は (0,-5) に置いた。

4.2.2 **多重散乱の測定結果**

1 気圧,0.5 気圧,0.2 気圧で Ar : C₂H₆ = 9 : 1 の混合ガス中での電子の多重散乱角の測定を 行った。得られた多重散乱角のヒストグラムを図 4.14、図 4.16、図 4.18 に示す。また、そ れぞれの気圧における多重散乱角の理論的なヒストグラムは図 4.13、図 4.15、図 4.17 に示 す。測定した多重散乱角のヒストグラムと理論的なヒストグラムを見比べると、小さい角度 においては測定結果と理論が一致しているように見え、大きい角度にでは全く一致していな いように見えた。つまり $\sigma_1 \ge \sigma_2$ は違う現象による角度分布が見えているのではないかと 考え、測定結果をダブルガウス分布でフィットした。小さい方の分散を σ_1 、大きい方の分散 を $\sigma_2 \ge 0$ た。その $\sigma_1 \ge \sigma_2 \ge 0$ 分散の理論値は表 4.2 に示す。また図 4.19 は縦軸に多重散乱 角 [rad]、横軸に気圧 [atm] を取って、多重散乱角の理論値 $\ge \sigma_1 \ge \sigma_2 \ge 0$ プロットしたもので ある。

表 4.2: 多重散乱角の分散の理論と測定結果の比較

気圧 [atm]	理論の σ [rad]	$\sigma_1[\mathrm{rad}]$	$\sigma_2[rad]$
0.2	1.2×10^{-1}	$1.18 \times 10^{-1} \pm (2.9 \times 10^{-2})$	$1.1 \pm (5.2 \times 10^{-2})$
0.5	2.2×10^{-1}	$1.80 \times 10^{-1} \pm (2.9 \times 10^{-2})$	$1.1 \pm (4.8 \times 10^{-2})$
1	2.9×10^{-1}	$2.81 \times 10^{-1} \pm (4.2 \times 10^{-2})$	$1.2 \pm (6.4 \times 10^{-2})$



図 4.13: 1 気圧中での多重散乱角の理論的な 分布 図 4.14: 1 気圧中での多重散乱角のヒストグラ ム。ダブルガウス分布によるフィットも合わせ て示す。



図 4.15: 0.5 気圧中での多重散乱角の理論的な 分布 図 4.16: 0.5 気圧中での多重散乱角のヒストグ ラム。ダブルガウス分布によるフィットも合わ せて示す。



図 4.17: 0.2 気圧中での多重散乱角の理論的な 分布 図 4.18: 0.2 気圧中での多重散乱角のヒストグ ラム。ダブルガウス分布によるフィットも合わ せて示す。



図 4.19: 多重散乱角の圧力依存(青は理論、赤は σ₁、緑は σ₂)

(1) 考察

図 4.19 を見るとどの気圧においても σ_1 と理論値と測定結果の誤差は 20%以内で一致して いることが解るが、 σ_2 と理論値とのズレがかなり大きいことが解る。また、 σ_1 に関しては、 気圧依存性が確認できるが、 σ_2 に関しては気圧依存性は確認できない。

以上のことから、今回の測定で得られた多重散乱角のヒストグラムは2つの違う現象が見えていると思われる。つまり今回観測したい多重散乱はσ1のイベントで、σ2は多重散乱角ではない何か違うイベントが見えているのではないかと考えた。

そこで多重散乱角が2radよりも大きいイベントを見てみると、多重散乱角が2rad以上のイベントは大きく分けて3種類あることが解った。

1つ目は極端に点と点の距離が離れているイベントである (図 4.20, 図 4.21)。



図 4.20: 点と点が離れすぎているイベント例1(左:アノード-カソード平面,右:ドリフト-カ ソード平面)



図 4.21: 点と点が離れすぎているイベント例2 (左:アノード-カソード平面, 右:ドリフト-カ ソード平面)

同時刻に複数のイベントが見えているものや、ノイズによるものが考えられるので、これ に関しては点の密度がある一定値よりも小さいイベントはカットすることで解消できると考 えられる。

2つ目はドリフト方向に運動している電子が多重散乱によって曲がってしまうイベントである。(図 4.22, 図 4.23)。



図 4.22: ドリフト方向に運動している電子が散乱されて曲がったイベント例1(左:アノー ド-カソード平面,右:ドリフト-カソード平面)



図 4.23: ドリフト方向に運動している電子が散乱されて曲がったイベント例2 (左:アノード-カソード平面, 右:ドリフト-カソード平面)

3つ目はアノード-カソード平面に飛跡を射影した長さが短すぎるイベントである。(図 4.24)。



図 4.24: アノード-カソード平面の飛跡の距離が短すぎるイベント

2つ目と3つ目に関しては、3次元の運動を2次元に射影したことによると考えられる。つ まり電子の飛跡を3次元のまま解析すれば、解消できるはずである。以上のことにより、解 析方法を3次元に改善すれば、多重散乱角が2radを超えるようなイベントはなくなり、角 度分布は理論値とかなり一致することが予測される。

4.2.3 多重散乱のまとめ

- 多重散乱の測定を行った結果、散乱角の分布は double gausian でよく fit されるという結果が得られた。それぞれの gausian のσを σ₁,σ₂ とした時、σ₁ が理論的な多重散乱と一致した。
- σ₁が今回観測したい多重散乱角のイベントの角度分布で、σ₂は解析方法が、3次元の 電子の飛跡を2次元に射影して考えたことによって生じた角度分布である。
- 電子の飛跡を3次元のまま解析すれば、理論的な多重散乱角の角度分布と多重散乱角の測定結果が一致することが予測される。

4.3 宇宙線µ粒子を用いた位置分解能とサンプリングピッチの測定

(担当:礒江麻衣)

ダブルベータ崩壊検出のための検出器の位置分解能はシミュレーションから 0.14cm 以下 であることが要請され、飛跡のサンプリングピッチは 0.1cm 以下であることが要請される。 宇宙線μ粒子を用いて検出器の位置分解能とサンプリングピッチを測定し、この要請値が満 たされるか考察した。

4.3.1 セットアップ



図 4.25: 左上:検出器の概略図 右上:データ取得の写真 下:シンチレーターの写真

clearpage

図 4.25 のように検出器の上下にシンチレータを置き、2 つのシンチレーターの信号のコ インシデンスをトリガーにして μ 粒子の飛跡を取得した。データ収集システムを図 4.26 に 示す。アノード、カソードは ASD によって増幅され、トリガー信号が入るとエンコーダー で 100MHz のクロックで計測され、位置情報として出力される。この位置情報はメモリー ボードに貯められる。またカソードを 8ch に分け、さらに 2ch ずつまとめた信号を FADC で 取得し電荷情報も得られるようになっている。



図 4.26: 装置のデータ取得システムの概略図

4.3.2 µ粒子の飛跡の取得

位置分解能、サンプリングピッチの気圧による変化を調べるため、Ar/C₂H₆(9:1)で1 気圧、0.5 気圧と気圧を変化させて測定を行った。より細かなサンプリングピッチを得るた め、アノードや GEM の電圧は放電しない極限まで上げ、ガス利得がなるべく大きくなるよ う設定した。詳細な条件は表1に示す。これらの条件で取得したµ粒子の飛跡の例を図 4.27 に示す。

	条件1	条件2
ガス	Ar/C ₂ H ₆ 9:1(1 気圧)	Ar/C ₂ H ₆ 9:1(0.5 気圧)
ドリフト	-2275V	-2500
GEM 上	-640V	-769V
GEM 下	-300V	-439V
アノード	$580\mathrm{V}$	460V



表1 検出器の設定

図 4.27: 取得したµ粒子の飛跡 点はµ粒子が検出器を通過したときの、ヒット点をプロットしたもので、枠は検出器を示す。

4.3.3 ガス利得の測定

宇宙線 μ 粒子は MIP であるとし、測定した dE/dx からガス利得を出した。Ar/C₂H₆(9:1) での dE/dx は文献値から計算すると 1 気圧では、dE/dx = 2.16[keV/cm]、0.5 気圧では、 dE/dx = 1.08[keV/cm] となる。得られた電荷情報を飛跡の長さで割った値を dE/dx とし、 作成した図したヒストグラムを図 4.28 に示す。曲線はヒストグラムをランダウ分布でフィッ トしたものである。ピークの位置が 1 気圧では 2.16keV/cm、0.5 気圧では 1.08keV/cm に 対応することから、ガス利得を計算した。結果を表 2 に示す。



図 4.28: µ粒子の dE/dx

	1 気圧	0.5 気圧
ガス利得	15300	41800
表	2 ガス	利得

1 章より Ar 気体で MIP を見るのに必要なガス利得は 1 気圧で 20000 以上で 0.5 気圧で 40000 以上とされている。1 気圧ではこの条件を満たすことができなかったが、0.5 気圧で は満たすことができた。

4.3.4 サンプリングピッチの測定

(1) サンプリングピッチの限界値

荷電粒子が検出器を通ると、ガス分子のイオン化により一次電子が生成され、一次電子のエネルギーが十分高ければ、さらに二次電子が生成される。これらの電子を増幅させ読み出すことで、飛跡を得ている。イオン化により生成される全電子 n_t について

$$n_{t} = \frac{\Delta E}{w} \tag{4.6}$$

が成り立ち、サンプリングピッチの限界の1つになっている。 ΔE は荷電粒子が落とすエネ ルギーで、w はガス分子1つがイオン化するのに必要なエネルギーである。MIP に対する 全電子 n_t と一次電子の数 n_p は多くの気体で測定されていて、A_r 気体1気圧では文献値よ り、n_t = 94[/cm]、n_p = 29.4[/cm] である。1気圧のA_r 気体では一次電子は、

$$\frac{1}{n_{\rm p}} \sim 300 \mu {\rm m} \tag{4.7}$$

となり、およそ 300 μ m に 1 つの割合で生成され、さらに二次電子が生成される。この電子 を増幅し、信号として捉えることができれば、サンプリングピッチはおよそ 300 μ m にな る。さらに 0.5 気圧ならば、dE/dx が半分になるので、サンプリングピッチはおよそ 600 μ m になると見積もることができる。しかし、この電子による信号をすべて捉えることは難 しく、この限界値に近づけるためには、ガス利得が重要である。さらに、サンプリングピッ チは μ PIC のピクセルピッチ 400 μ m によっても制限される ([4] 参照)。

4.3.5 サンプリングピッチの測定結果

取得した飛跡の長さをヒット数で割ることでサンプリングピッチを計算した。1気圧、0.5 気圧でのサンプリングピッチのヒストグラムを図 4.29 に示す。



図 4.29: サンプリングピッチ ヒストグラム

サンプリングピッチの mean は1気圧で 0.35cm、0.5気圧で 0.43cm となり、この条件で は要請値 0.1cm を満たさない。さらに上で議論した限界値と比較するとガス利得が十分で ないことが分かる。0.5気圧ではガス利得が1章での必要な値を満たしているにも関わらず、 まだ不十分であることが分かった。

4.3.6 検出器の位置分解能の測定

(1) 位置分解能の理論値

検出器の位置分解能はドリフト長zの関数で、

$$\sigma^{2}(z) = \sigma^{2}_{detector} + (D\sqrt{z})^{2}$$
(4.8)

と表せる。 $\sigma_{detector}$ は検出器固有のパラメーターであり、 $(D\sqrt{z})^2$ は電子の拡散に関する項である。ここで、Dは拡散係数でzはドリフト長を示す。

検出器の z = 0 での二次元位置分解能 $\sigma_{detector}$ $\sigma_{detector}$ は (1) 式から分かるように 検出器の z=0 での位置分解能である。 $\sigma_{detector}$ に最も大きく寄与するのは、 μ PIC の位置 分解能である。ここでは μ PIC の位置分解能のおおよその値を考える。 まず一次元分解能 σ_0 を考える。 μ PIC のピクセルピッチは 400 μ m であるから、400 μ m の区間内のヒット は、その区間の中心の座標がデータとして得られるとする。

区間の幅を1として、区間のヒット点がすべて、x=0のデータとして得られるとすると、 その分散 σ_0 は

$$\sigma_0^2 = \frac{1}{l} \int_{\frac{1}{2}}^{-\frac{1}{2}} x^2 dx = \frac{l^2}{12}$$
(4.9)

l=400 μ m とすると

$$\sigma_0 = \frac{400\mu m}{\sqrt{12}} = 115\mu m \tag{4.10}$$

これに $\sqrt{2}$ をかけて、二次元分解能 $\sigma_{detector}$ を計算する。

$$\sigma_{\text{detector}} = 163\mu\text{m} \tag{4.11}$$

電子の拡散と拡散係数 本実験で用いた検出器は、荷電粒子が検出器内を通った時に生成される電子を電場でµPICまでドリフトさせ、その電子を読み出すことにより飛跡を得る。電子がµPICまでドリフトさせる間、xy座標を保ちながら動くことが重要だが、電子はガス中での散乱で拡散するため、その軌道が乱される。よって位置分解能は、この電子の拡散にも大きく依存している。電子の拡散はガウス分布で表され、電場や磁場がなければ、t秒後、元の位置から x 離れた位置にある電子の割合は

$$\frac{dN}{N} = \frac{1}{\sqrt{4\pi D't}} e^{-(x^2/4D't)} dx$$
(4.12)

となる。この分散は $\sigma_x = \sqrt{2D't}$ である。D' は拡散係数であり、ガスの種類や圧力に依存 する。

電場があるとき、拡散係数 D' が電場に依存して変化する。分散を σ_x 時間 t の関数からドリフト長 z の関数にすると

$$\sigma_{\rm x} = \sqrt{2{\rm D't}} = \sqrt{2{\rm D'}\frac{\rm x}{\rm w}} = {\rm D}\sqrt{\rm z} \tag{4.13}$$

となる。w は電子のドリフト速度でありガスの種類、気圧、電場に依存する。D は、拡散を 距離の関数であらわすときの拡散係数である。 1 気圧、0.5 気圧の拡散係数は文献値よりそ れぞれ 583 μ m、559 μ m である ([4]、[1] 参照)。

4.3.7 位置分解能の測定結果

宇宙線µ粒子飛跡は直線になる。µ粒子の飛跡とそのフィット直線との距離を残差dとし、残差dのヒストグラムの2次元ガウス分布フィットでの標準偏差を位置分解能として得た。

残差の解析方法を説明する。まず飛跡の xz 平面、yz 平面射影をそれぞれ直線フィットする。xz 平面でのフィット直線を y 任意に動かし平面を作り、同様に yz 平面でのフィット直線 を x に動かし平面を作り、この2つの平面の交線を飛跡の三次元フィット直線として得た。 さらに得られた三次元フィット直線と飛跡の三次元の距離を測定し、残差 d を得た。残差 d をドリフト距離毎に、ヒストグラムにしたものを図 4.30、4.31 に示す。



図 4.30: 条件1における残差のヒストグラム x 軸:残差 (cm)



図 4.31: 条件 2 における残差のヒストグラム x 軸:残差 (cm)

図 4.30、4.31 についてドリフト長 z が大きくなるほどイベント数が減っているが、これ は電子がガスの分子に捕獲される割合が増えるためだと考えられる。また図 4.31 ではドリ フト長 z が 1cm 以下のイベントがほとんどない。検出器の z 軸方向の大きさは、10cm であ るが、データから飛跡を再構成すると z が 10cm 以上のイベントがいくつか見つかったこと から、z 座標の再構成に何か問題があることが考えられる。図 4.30、4.31 の曲線はヒストグ ラムを二次元ガウスでフィットしたものである。フィット関数は 4.14 式に示す。 po、d を フィッティングパラメーターとした。 po は標準偏差である。

$$\frac{\sqrt{2\pi}}{p_0} dexp(-\frac{d^2}{2p_0^2})$$
(4.14)

標準偏差のz依存性は図 4.32、4.33 のようになった。



図 4.32: 1気圧における残差のドリフト長依存性



図 4.33: 0.5 気圧における残差のドリフト長依存性

図 4.32、4.33 の曲線は $\sigma^2(z) = \sigma_{detector}^2 + (D\sqrt{z})^2$ でフィットしたものであり、直線は要請値 (0.14cm) を示す。検出器の全範囲で位置分解能が要請値を満たしていると言える。パラメーターを表 3 に示す。

	1 気圧	0.5 気圧		
$\sigma_{ m detector}$	$599 \pm 127 \mu \mathrm{m}$	$189\pm106\mu\mathrm{m}$		
D	$393 \pm 106 \mu \mathrm{m}$	$425\pm61\mu\mathrm{m}$		

 $\sigma_{detector}$ の結果について、0.5気圧では、1.1.の(3)の値を誤差の範囲で満たしている。しかし1気圧では、満たしておらず、これはデータの数が少なく、精度が足りないためだと考えられる。

4.3.8 位置分解能とサンプリングピッチのまとめ

- 位置分解能は Ar : C₂H₆ = 9 : 1、1気圧で 0.06cm < σ < 0.14cm、0.5気圧で 0.02cm < σ < 0.14cm となり、どちらもダブルベータ崩壊検出の要請値を満たす。
- サンプリングピッチはダブルベータ崩壊検出の要請値を満たさず、より大きなガス増 幅が必要である。

第5章 まとめ

5.1 ダブルベータ崩壊を観測するための要請

- 数値計算の要請
 ・多重散乱角の大きさは 5~10 度 (0.2 気圧以下)
 ・ガス利得は 20000/p 以上
- 装置の要請
 ・磁極間隙中心からの必要な領域における磁場のずれ±20%
- シュミレーションによる要請 エネルギー分解能 20%を得る為には、
 - ・気圧は 0.3 気圧以下
 - ・サンプリングピッチは 1mm 以下
 - ・位置分解能は1.4mm以下

5.2 実験結果

- 0.2 気圧で電子の飛跡を観測するのに必要なガス利得 10⁵ を得るためには、アノードの 印加電圧を 416V まで上げれば可能と予測される。
- 電子の飛跡を3次元のまま解析すれば、理論的な多重散乱角の分布と多重散乱角の測 定結果が一致することが予測される。
- サンプリングピッチはダブルベータ崩壊検出の要請値を満たさなかったが、位置分解 能は、1気圧、0.5気圧ともにダブルベータ崩壊検出の要請値を満たす。0.2気圧での 位置分解能は、測定する必要がある。

謝辞

本研究を進めるにあたり、多くの方に丁寧なご指導、助言を賜りましたことを深く感謝い たします。

特に、藏重教授、身内准教授には、研究に行き詰まった際には適切な助言を与えてくださり、 要領を得ない私たちに夜分遅くまで、辛抱強くご指導をしていただきました。竹内教授、原 准教授、越智助教、鈴木助教には、分からないことで質問に答えてくださったり、研究報告 の際などに的確な助言をいただきました。

また、研究室の先輩方には、解析やシュミレーションの方法など、多くの助言をいただきま した。同期のメンバーには、ともに励まし合ったり、分からないことを協力して解決したり と多くの助けをもらいました。本研究は、粒子物理学研究室の皆様のご助力なしでは、決し て行えませんでした、深く感謝いたします。

本当にありがとうございました。

参考文献

- [1] 高橋 慶在:電子飛跡検出型 MeV y 線コンプトンカメラに用いるガスの組成最適化 と高圧化 京都大学大学院修士論文,2005.
- [2] 服部 香里: μ-PIC を用いた MeV y 線カメラの高感度化 京都大学大学院修士論 文,2005.
- [3] 高田 淳史: µ-PIC を用いた MeV y 線イメージングカメラの開発 京都大学大学 院修士論文,2005.
- [4] F.Sauli: Principles of operation of mulitiwire proportional and drift chambers, CERN 77-09,1997.
- [5] William R.Leo: Techniques for Nuclear and Physics Experiment: A How-to Approach, Springer, 1994.
- [6] Particle Data Group : Review of Particle Physics(volume3)
- [7] 渡邊 靖志:素粒子物理入門(新物理学シリーズ 33, 培風館, 2011).
- [8] タカノ技研による設計、計算
- [9] http://www.kek.jp/ja/NewsRoom/Release/20110303160120/.